

等离子去胶机

所属学校:重庆大学

仪器基本信息				仪 器 编 号		08023817		
				仪器英文名称		Plasma Stripping Machine		
				所属校内单位		光电工程学院		
				放 置 地 点		A 区微系统研究中心 MEMS 工艺间		
				仪器负责人		尚正国	制造商国别	中国
				制 造 厂 商		奥威天长半导体技术发展有限公司		
				规 格 型 号		IPC3000S		
				仪 器 原 值		24.26 万元	购置日期	2008.12
仪器性能信息	主要技术指标	PLC 控制装置,等离子 RF 频率在 13.56MHz 起辉,系统功率≤2KW(0 ~ 650W 可调)。						
	主要功能及特色	去除光刻残胶及扫底模,具有自动和手动功能,探针台得样品可左右前后调节。						
相关科研信息	主要研究方向	通讯、生物医学等领域。						
	在研或曾承担的重大项目	国防 973、集成低电压电泳生化分析系统芯片、一种新型声波生化传感器及其集成技术研究、真空、微流体芯片制作,硅微通道列阵形成技术。						
	学术 论文	近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:						
		序号	作者	论文题目	期刊名称	年	卷(期)	起止页
		1	张智海	光栅平动式光调制器的残余应力自测量方法和试验	机械工程学报	2010	46(8)	12-17
		2	金珠	直梁结构光栅光调制器的机电特性分析与实验	纳米技术与精密工程	2010	1(8)	42-46
专利或奖项								
共享服务信息	收费标准	联盟外	根据具体实验项目协商					
		联盟内	根据具体实验项目协商					
	联系信息	联系人	尚正国	联系电话	65102519	电子邮件	zhengry@cqu.edu.cn	
	开放时间	提前预约						